(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

30 MAR 2005

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



### HARLING HARLING

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 8. April 2004 (08.04.2004)

### (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/029323 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation7:
  - C23C 14/08,
- (21) Internationales Aktenzeichen: (22) Internationales Anmeldedatum:

PCT/CH2003/000653

30. September 2003 (30.09.2003) (25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

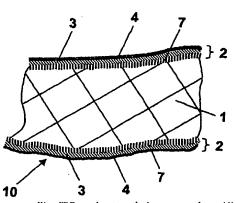
(30) Angaben zur Priorität: 1630/02 30. September 2002 (30.09.2002)

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INCOAT GMBH [CH/CH]; Alte Landstrasse 105,
- CH-8803 Rüschlikon (CH).
- (72) Erfinder: und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MOSER, Eva, Maria [CH/CH]; Quellenweg 9, CH-8224 Löhningen (CH).

- (74) Anwälte: BREITER, Heinz usw.; Breiter + Wiedmer AG, Seuzachstrasse 2, Postfach 366, CH-8413 Neftenbach (CH).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT (Gebrauchsmuster), AT, AU (petty patent), AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ (Gebrauchsmuster), CZ, DE (Gebrauchsmuster), DE, DK (Gebrauchsmuster), DK, DM, DZ, EC, EE (Gebrauchsmuster), EE, EG, ES, FI (Gebrauchsmuster), FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK (Gebrauchsmuster), SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,

l Fortsetzung auf der nächsten Seite

- (54) Title: COMPOSITE MATERIAL
- (54) Bezeichnung: VERBUNDWERKSTOFF



or crystalline TiO2, at least partly in an upper layer (4).

(57) Abstract: A composite material (10) comprises a substrate (1) and a chemically-, mechanically-, physically-, catalytically- and/or opticallyfunctional titanium oxide layer (2), applied on at least one side thereof. A titanium oxide layer (2) is deposited on the substrate (1), as a base layer (3), made from TiO<sub>x</sub> with an oxygen content of  $0.7 \le x < 2$ , or made from  $TiO_X$  (OH)<sub>y</sub> with an oxygen content of  $0.5 \le x < 2$  and a hydroxide content of  $0 \le y < 0.7$  and an upper layer (4) of amorphous and/or crystalline TiO<sub>2</sub> applied to said base layer (3). In a first method variation, firstly a base layer (3) of  $TiO_X$  with an oxygen content of  $0.7 \le x < 2$  is reactively or non-reactively deposited, then, through an increase in the oxygen content, the process pressure, the capacity and/or the substrate temperature, an upper layer (4) of amorphous and/or crystalline TiO2 is deposited. In a second method variation, firstly a base layer (3) of TiOx with an oxygen content of  $0.7 \le x < 2$  is reactively or non-reactively deposited and then post-oxidised on the surface by means of an electrochemical, thermal and/or plasma process, until the base layer (3) is converted into amorphous

(57) Zusammenfassung: Ein Verbundwerkstoff (10) besteht aus einem Substrat (1) und einer wenigstens einseitig aufgebrachten chemisch, mechanisch, physikalisch, katalytisch und/oder optisch funktionalen Titanoxidschicht (2). Auf dem Substrat (1) ist eine Titanoxidschicht (2) aus einer Grundschicht (3) aus  $TiO_X$  mit einem Sauerstoffgehalt von  $0.7 \le x < 2$  oder aus  $TiO_X$  (OH), mit einem Sauerstoffgehalt von  $0.5 \le x < 2$  und einem Hydroxidgehalt von  $0 \le y < 0.7$  und auf dieser Grundschicht (3) eine Oberschicht (4) aus amorphem und/oder kristallinem TiO2 aufgebracht. Nach einer ersten Verfahrensvariante wird vorerst reaktiv oder nicht reaktiv eine Grundschicht (3) auf TiOx mit einem Sauerstoffgehalt von 0.7 ≤ x < 2, dann durch Erhöhen des Sauerstoffgehalts, des Prozessdrucks, der Leistung und/oder der Substrattemperatur, eine Oberschicht (4) aus amorphem und/oder kristallinem TiO2 abgeschieden. Nach einer zweiten Verfahrensvariante wird vorerst reaktiv oder nicht reaktiv eine Grundschicht (3) aus TiOx mit einem Saucrstoffgehalt von 0.7 ≤ x < 2 abgeschieden und anschliessend elektrochemisch, thermisch und/oder mit einem Plasmaprozess an der Oberfläche postoxidiert, bis die Grundschicht (3) wenigstens teilweise in eine Oberschicht (4) aus amorphem oder kristallinem TiO2 umstrukturiert ist.

WO 2004/029323 A1



TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht

1

#### Verbundwerkstoff

Die Erfindung bezieht sich auf einen Verbundwerkstoff aus einem Substrat mit einer wenigstens einseitig aufgebrachten chemisch, physikalisch, mechanisch, katalytisch und/oder optisch funktionalen Titanoxidschicht. Weiter betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung und Verwendungen des Verbundwerkstoffs.

10

Der weite Begriff Substrat umfasst einerseits leicht entflammbare und/oder wärmeempfindliche Werkstoffe aus Polymeren, polymerartigen oder natürlichen Materialien, aber andererseits auch Werkstoffe aus Metallen, Glas, Keramik und Kombinationen daraus (Komposit-Werkstoffe), bei welchen aus verfahrenstechnischen Gründen ein Beschichtungsprozess bei niedrigen Temperaturen vorgezogen wird. Die Substrate werden mit keramischen Titanoxidschichten, welche eine oder mehrere Schutzwirkung erfüllen und damit beispielsweise die Sicherheit im täglichen Umgang mit leicht entflammbaren und/oder leicht zu verunreinigenden Werkstoffen erhöhen.

20

25

30

15

Das Brennverhalten von Werkstoffen (insbesondere Textilien, Folien und Behälter aus Kunststoffen) und deren Einschätzung des Brandrisikos ist von großer Bedeutung, weil sie stets den Menschen umgeben. Textilien werden beispielsweise in einer Vielzahl von Anwendungen, hauptsächlich als Kleidung, Heimtextilien und technischen Textilien, eingesetzt. Der Verbrennungsprozess wird durch Erwärmung, Zersetzung und Zündung des brennbaren Werkstoffes eingeleitet. Je nach seiner Beschaffenheit wird der Werkstoff unter Wärmeeinwirkung zunächst schmelzen, fließen oder unverändert bleiben und sich bei weiterer Energiezufuhr schließlich zersetzen und dabei Wärme entwickeln. Nach Zündung des brennbaren Werkstoffs findet die Flammausbreitung über seine zersetzte Oberfläche statt, wobei die Geschwindigkeit der Flammausbreitung mit der Wärmeabgabe des Materials einhergeht. Neben der Entzünd-

### BESTÄTIGUNGSKOPIE

barkeit sind deshalb Flammausbreitung und der Grad der Wärmeabgabe brandbestimmende Parameter.

Der geforderte Flammschutz kann traditionell auf verschiedene Arten erreicht werden. Einerseits können intrinsisch flammgeschützte Polymere wie Polyvinylchlorid (PVC) oder Fluorpolymere verwendet werden. Brennbare Polymere wie Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) oder Polyamid (PA) können mit diversen flammhemmenden Füllstoffen (z.B. Aluminiumhydroxid, Magnesiumhydroxid, organische Bromverbindungen) ausgerüstet werden. Meistens ist jedoch ein hoher Anteil dieser Füllstoffe in der Polymermatrix erforderlich, um einen ausreichenden Flammschutz zu erzielen. Dies äussert sich in einer hohen Dichte, mangelnden Flexibilität und niedrigen mechanischen Eigenschaften des Werkstoffes.

- Titandioxid (TiO<sub>2</sub>) hat bekannte Eigenschaften als Photohalbleiter, einen hohen Brechungsindex, eine hohe Transparenz im sichtbaren und im Infrarot-nahen Wellenlängenbereich, eine hohe dielektrische Konstante, weist einen sehr guten Verschleissschutz auf, ist chemisch inert und hat schliesslich hervorragende thermische Eigenschaften. TiO<sub>2</sub> kristallisiert in drei Modifikationen: tetragonales Rutil, Anatase und orthorombisches Brookit. Es sind spezielle experimentelle Bedingungen erforderlich, um Brookit herstellen zu können. Rutil ist für optische Anwendungen interessant, währenddem bei Anatase die photokatalytischen Eigenschaften infolge der optischen Bandlücke von 3.2 eV ausgeprägter sind.
- Es sind zahlreiche Suboxide von Titan (TiO<sub>x</sub>) mit einem Sauerstoffgehalt von  $0.7 \le x < 2$  bekannt, TiO<sub>x</sub> mit einem Sauerstoffgehalt von 0.7 < x < 1.5 hat bei Raumtemperatur einen elektrischen Widerstand von etwa 400  $\mu\Omega$  cm, bei einem höheren Sauerstoffgehalt nimmt dieser rasch zu, TiO<sub>2</sub> ist ein Isolator.
- 30 Es ist bekannt, dass bei TiO<sub>2</sub>—Schichten die Kristallinität und deren Modifikationen von der Herstellungsmethode, den Prozessparametern und der Beschichtungskonfiguration abhängen. Meistens werden kristalline TiO<sub>2</sub>-Schichten mit

20

25

30

Sol-Gel Prozessen, Spray-Pyrolyse, Lackierung, Elektronenstrahlverdampfung oder metall-organisch chemischer Verdampfung (MOCVD) oberhalb 300 °C hergestellt. TiO<sub>2</sub>-Schichten, welche mit reaktiver Verdampfung oder Plasma aktivierter chemischer Verdampfungsmethoden (PACVD) unterhalb 300 °C hergestellt werden, sind üblicherweise amorph und weniger dicht. Werden diese amorphen Schichten zwischen 300-500 °C getempert, ist die Struktur Anatase der TiO<sub>2</sub> dominant, bei einer Wärmebehandlung oberhalb 600 °C bildet sich die TiO<sub>2</sub>- Modifikation Rutil.

Andererseits können amorphe oder kristalline TiO<sub>x</sub>- bzw. TiO<sub>2</sub>-Schichten unterhalb 300 °C mit Methoden, welche durch eine höhere Teilchenenergie charakterisiert sind - wie z.B. reaktives oder nicht-reaktives Magnetron Sputtern (Kathodenzerstäubung), nicht gefilterte oder gefilterte Funken-Entladung, Ionenstrahlassistierte Abscheidungen (IAD) und gepulste Laserabscheidungen - erzeugt werden. Mit RF-Sputtern kann entsprechend der Wahl der Beschichtungsparameter TiO<sub>2</sub> amorph oder kristallin auf ein ungeheiztes Material abgeschieden werden.

In der SURFACE AND COATINGS TECHNOLOGY 102 (1998), 67 - 72 werden dünne Titandioxidschichten beschrieben, welche durch RF-Sputtern in einer Argon-Sauerstoff-Atmosphäre abgeschieden worden sind. Die Mikrostrukturen der TiO<sub>2</sub>-Abscheidungen variieren in einem breiten Bereich, von kompakt bis porös und säulenförmig. Das Verhältnis O/Ti wird mit zunehmendem Druck grösser, wenn die übrigen Reaktionsparameter unverändert bleiben. Die Publikation beschäftigt sich schwergewichtig mit wissenschaftlichen Untersuchungen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Verbundwerkstoff und ein Verfahren zu dessen Herstellung mit einer funktionalen Titanoxidschicht der eingangs genannten Art zu schaffen, welche verbesserte, insbesondere synergetische Funktionalitäten für einen breiten Bereich von Substraten bringt. Eine

Wechselwirkung von Sauerstoff und anderen reaktiven Gasen mit dem Substrat sollen verhindert und dieses thermisch isoliert werden.

Bezüglich des Verbundwerkstoffs wird die Aufgabe erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass auf dem Substrat eine Titanoxidschicht aus einer Grundschicht aus TiO<sub>x</sub> mit einem Sauerstoffgehalt von  $0.7 \le x < 2$  oder aus TiO<sub>x</sub> (OH)<sub>y</sub> mit einem Sauerstoffgehalt von  $0.5 \le x < 2$  und einem Hydroxidgehalt von  $0 \le y < 0.5$  und auf dieser Grundschicht eine Oberschicht aus amorphem und/oder kristallinem TiO<sub>2</sub> aufgebracht ist. Spezielle und weiterbildende Ausführungsformen des Verbundwerkstoffs sind Gegenstand von abhängigen Patentansprüchen.

Das Substrat mit einer Grundschicht und einer Oberschicht, allenfalls auch mit weiteren Schichten, wird hier und im übrigen einfachheitshalber als Verbundwerkstoff bezeichnet. Weiter umfasst, um Wiederholungen zu vermeiden, die Bezeichnung TiO<sub>x</sub> stets auch die Variante TiO<sub>x</sub> (OH)<sub>y</sub>. Die BezeichnungenTiO<sub>x</sub>, TiO<sub>x</sub> (OH)<sub>y</sub> und TiO<sub>2</sub> umfassen reine Titanoxidschichten, aber auch Titanoxidschichten mit anderen Metalloxiden, wobei die Grundschicht insgesamt weniger als 50 Gew.-%, die Oberschicht insgesamt weniger als 7 Gew.-% von anderen, im Folgenden detailliert aufgeführten Metalloxiden enthält.

20

25

15

10

Bei der erfindungsgemässen Titanoxidschicht handelt es sich um eine multifunktionale Schicht, welche ein Substrat z.B. vor Entflammung, Verunreinigung,
Degradation (Migration von Additiven, Photooxidation) schützt. Dadurch kann
ein beliebiges Material mit einer Flammschutzwirkung, einer Hygieneschutzwirkung (Selbstreinigung, keimabtötende Wirkung), einem Anti-Statik-Schutz
und/oder einem Anti-Fogging-Effekt ausrüstet werden. Ein solcher Verbundwerkstoff eignet sich beispielsweise für den Einsatz im medizinalen Bereich, für
Wohnaccessoires, Haushaltartikel, Textilien, Tapeten, Kabel und Photovoltaik
sowie in Reinigungsanlagen für Wasser, wässrige Lösungen und Luft.

30

Als zu schützende Materialien besonders geeignet sind leicht entflammbare und/oder wärmeempfindliche Materialien wie Polymere, tiefschmelzende Me-

talle, Komposit-Werkstoffe und Naturstoffe in Form von starren bis flexiblen Folien, Geweben, Membranen, Fasern, Rohren, Platten, Behältern und Pulvern.

Die Titanoxidschicht hat vorzugsweise eine gesamte Schichtdicke von 3 bis 1000 nm, wobei mindestens etwa 10% der gesamten Schichtdicke aus der Oberschicht besteht. Die Oberschicht besteht aus Titandioxid, TiO<sub>2</sub>, in der Praxis ist der Übergang jedoch fliessend, ein Wert von TiO<sub>1,99</sub> beispielsweise kann auch der Oberschicht zugerechnet werden. Weiter sind in der Praxis hauchdünne Schichten von nur 3 nm eher selten, zweckmässig liegt die gesamte Schichtdicke im Bereich von 10 bis 300 nm, insbesondere 20 bis 150 nm, wobei 10 bis 50% der gesamten Schichtdicke aus der Oberschicht bestehen.

Beim Einsatz von Kunststoff- und Naturstoffsubstraten (insbesondere Wolle und Baumwolle) kann eine Titandioxidschicht problematisch werden, sie kann auch als Katalysator eine Zersetzung der Oberfläche des Substrates auslösen. Bei Kunststoffen und Naturstoffen kann es deshalb angebracht sein, vor dem Auftragen der Grundschicht aus TiO<sub>x</sub> eine Schutzschicht aus wenigstens einem Metalloxid der Gruppe, welche bevorzugt aus MgO, ZnO, ZrO<sub>2</sub>, In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und SiO<sub>2</sub> besteht und/oder eine polare Adhäsionsschicht als Haftvermittlungsschicht, aufzutragen. Die Wahl des optimalen Metalloxids oder der optimalen Mischung von Metalloxiden kann der Fachmann in Versuchen leicht ermitteln. Bei einer Grundschicht aus TiO<sub>x</sub> mit einem Sauerstoffgehalt x < 1.9 und/oder einem signifikanten Hydroxidgehalt von 0.2 < y < 0.7 besteht üblicherweise keine Gefahr für das Substrat.

25

5

10

15

20

Nach einer weiteren Variante der Titanoxidschicht kann zwischen der Grundschicht und der Oberschicht eine elektrisch leitende Zwischenschicht abgeschieden werden, welche vorzugsweise aus  $\text{TiO}_x$  mit einem Sauerstoffgehalt von  $0.5 \le x < 1.5$  besteht. Die elektrische Leitfähigkeit nimmt ab einem Sauerstoffgehalt von  $x \ge 1.5$  ab. Die Schicht kann nicht mehr als elektrisch leitend bezeichnet werden, eine Oberschicht aus  $\text{TiO}_2$  mit einem Sauerstoffgehalt von x = 2 ist ein Isolator. Offensichtlich wird eine elektrisch leitende Zwischenschicht

10

25

30

insbesondere abgeschieden, wenn der Sauerstoffgehalt der Grundschicht oberhalb x = 1.5 liegt und falls ein Antistatikeffekt erzielt werden soll.

Wie später detaillierter erklärt wird, bestehen mindestens die obersten neun Atomlagen der Oberschicht hauptsächlich aus der kristallinen TiO<sub>2</sub>-Modifikation Anatase, was einer Schichtdicke von etwa 3 nm entspricht.

Beim Einsatz der multifunktionalen Titanoxidschicht als Flammschutzschicht eines Kunststoffsubstrats können diesem submikrone Füllerpartikel aus einem Metalloxid, beispielsweise  $TiO_2$  und/oder  $Sb_2$   $O_3$ , oder aus einem bei Hitze wasserabspaltenden Metallhydroxid beigemischt, beispielsweise Al  $(OH)_3$  und/oder Sb  $(OH)_3$ . In diesem Fall hat die  $TiO_x$ -Grundschicht zweckmässig einen Sauerstoffgehalt von  $1.5 \le x \le 1.9$ .

In Bezug auf das Verfahren zum Abscheiden einer chemisch, physikalisch, mechanisch, katalytisch und/oder optisch funktionalen Titanoxidschicht auf einem Substrat wird die Aufgabe nach einer ersten Variante erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass vorerst eine reaktive Grundschicht aus TiO<sub>x</sub> mit einem Sauerstoffgehalt von 0.7 ≤ x < 2, dann durch Erhöhen des Sauerstoffgehalts, des Prozessdrucks, der Leistung und/oder der Substrattemperatur eine Oberschicht aus amorphem oder kristallinem TiO<sub>2</sub> abgeschieden wird.

Nach einer zweiten Variante wird die Aufgabe bezüglich des Verfahrens zum Abscheiden einer chemisch, physikalisch mechanisch, katalytisch und/oder optisch funktionalen Titanoxidschicht auf einem Substrat dadurch gelöst, dass vorerst reaktiv oder nicht reaktiv eine Grundschicht aus  $TiO_x$  mit einem Sauerstoffgehalt von  $0.7 \le x < 2$  abgeschieden und anschliessend elektrochemisch, thermisch und/oder mit einem Plasmaprozess an der Oberfläche postoxidiert wird, bis die Grundschicht wenigstens teilweise in eine Oberschicht aus amorphem oder kristallinem  $TiO_2$  umstrukturiert ist.

Nach beiden Verfahren entsteht eine Oberschicht aus TiO<sub>2</sub>. Die Verfahrensparameter sind so eingestellt, dass die Oberschicht in der Regel mindestens 10% der gesamten Schichtdicke ausmacht. Bei extrem dünnen Schichten kann nach der zweiten Variante die gesamte Grundschicht in eine TiO<sub>2</sub>-Schicht umstrukturiert werden, dies ist jedoch in der Regel nicht der Fall.

Das Auftragen erfolgt mit an sich bekannten, bereits vorstehend erwähnten Methoden, aus verfahrenstechnischen Gründen sind Beschichtungsprozesse bei niedrigen Temperaturen bevorzugt. Eine allfällige Zwischenschicht zwischen der Grund- und der Deckschicht und eine Schutzschicht zwischen dem Substrat und der Grundschicht werden ebenfalls nach einem der erwähnten bekannten Methoden abgeschieden.

Vorzugsweise wird insbesondere bei einem Kunststoffsubstrat oder nicht-polaren Material, die Grundschicht oder die Schutzschicht nach einer Plasmaaktivierung der Oberfläche des Substrats aufgetragen. Dadurch wird die Haftung der abzuscheidenden Schicht erhöht. Die Vorbehandlung kann auch mittels einer hauchdünnen polaren Plasmaschicht von wenigen Nanometern Dicke erfolgen. Diese polare Plasmaschicht erhöht einerseits die Haftung der Grundschicht und verhindert andrerseits eine Degradation des Substrats. Für die Erzeugung einer langzeitstabilen polaren Schicht wird auf die WO 99/39842 verwiesen, nach welcher für eine polare Beschichtung ein wasserfreies Prozessgas eingesetzt wird, das mindestens je eine auch substituierte Kohlenwasserstoffverbindung bis zu 8 C/Atomen und ein anorganisches Gas enthält.

25

30

10

15

20

Die keramische Beschichtung kann direkt anschliessend an die Oberflächenbehandlung des Substrats oder später erfolgen.

Nach einer Weiterausbildung des Verfahrens kann eine mit wenigstens einem Metalloxid gemischte Grundschicht aus TiOx abgeschieden werden. Als Metalloxide sind beispielsweise MgO, ZnO, ZrO<sub>2</sub>, In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und/oder SiO<sub>2</sub> geeignet, wobei der Anteil des TiO<sub>x</sub> nach dem Zumischen über 50 Gew.-%

bleibt. Weiter können der Oberschicht aus TiO<sub>2</sub> auch Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, WO<sub>3</sub>, MnO<sub>2</sub>, NiO, BaO und/oder CaO zudotiert werden, wobei der Antil des TiO<sub>2</sub> nach dem Dotieren über 93 Gew.-% bleibt. Werden der Grundschicht aus TiO<sub>3</sub> die Metalloxide beider Gruppen zugegeben, muss der gesamte Anteil aller Metalloxide unter 50 Gew.-% bleiben, der Anteil der zudotierten Metalloxide der zweiten Gruppe muss unter 7 Gew.-% bleiben.

Die erfindungsgemässe Abscheidung einer Grundschicht aus  $TiO_x$  (0.7  $\le x < 2$ ) und einer Oberschicht aus  $TiO_2$  bringt zahlreiche, nachstehend nicht abschliessend aufgelistete Vorteile.

- Das Verfahren kann bei ≤ 200°C Substrattemperatur durchgeführt werden, was insbesondere für Polymersubstrate wichtig ist. Auch bei metallischen, keramischen und Komposit-Werkstoffen und Kombinationen daraus kann ein Niedertemperaturprozess angezeigt sein.
- Die Abscheidung einer elektrisch leitfähigen TiO<sub>x</sub>-Schicht auf elektrisch nichtleitenden Substraten reduziert die elektrostatische Aufladung und unterstützt dadurch synergetisch den Hygieneschutz.

20

5

10

15

Die Beschichtung eines organisch-chemischen Substrates (Polymer, Naturstoff) mit einer Grundschicht aus  $TiO_x$  (x < 1.9) und/oder  $TiO_x$  (OH)<sub>y</sub> mit einem signifikanten Hydroxidanteil ist üblicherweise unproblematisch (keine Degradation).

25

30

Eine dünne Beschichtung hat den Vorteil, dass die mechanischen und verarbeitungstechnischen Eigenschaften des Substrats erhalten bleiben. Dies ist insbesondere wichtig bei einer Faser- und Folienbehandlung, welche anschließend noch mehrere Verarbeitungsprozesse zu überstehen haben. 5

10

15

20

- Mit einem plasmaaktivierten Verfahren können vorgegebene Schichteigenschaften, wie Porosität, Kristallinität, Dichte, elektrische Leitfähigkeit, Brechungsindex und Polarität, gezielt hergestellt werden. Insbesondere kann durch die Kombination von dichten mit porösen nanostrukturierten Multischichten, welche auch unterschiedliche elektrische Leitfähigkeit und Brechungsindexes aufweisen können, eine synergetische Funktionalität der Titanoxidschicht erzielt werden. Beispielsweise kann die Topographie des Substrates mit einer geeigneten Schichttopographie derart verändert oder ergänzt werden, dass diese die Reinigungs-Hygienefunktion synergetisch verstärken kann.
- Die synergetische Multifunktionalität der Titanoxidschichten kann der jeweiligen Anwendung angepasst werden kann. Die zur Herstellung der Schichtsysteme bevorzugten plasmaaktivierten Niedertemperatur-Verfahren, z.B. durch Magnetron Sputtern, Funken-Entladung und Plasma-MOCVD, eignen sich insbesondere dank der einfachen Prozessführung zur Variation der Stöchiometrie und der Schichtstruktur sowie der prozesstechnisch einfach durchführbaren Dotierung der Titanoxidschicht mit wenigstens einem Metalloxid, beispielsweise Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, zur Stabilisierung der Modifikation Anatase. Niedertemperatur-Verfahren sind deshalb auch für wärmeunempfindliche Materialien, wie Glas, interessant.

Dank einer erfindungsgemässen Titanoxidschicht mit einer Grundschicht aus TiO<sub>x</sub> und Oberschicht aus TiO<sub>2</sub>, welche eine Dicke von > 3 nm, insbesondere >10 nm hat, ist auf praktisch allen Substraten ein Hygieneschutz, eine Biokompatibilität, ein Anti-Fogging Effekt und somit ein aktiver Flammschutz erzielbar. Dank der darunterliegenden TiO<sub>x</sub>-Grundschicht ist auch eine Biokompatibilität, ein Degradationsschutz des Substrates, ein passiver Flammschutz, ein Antistatik-Effekt, ein Migrations- und ein Diffusionssperrschutz gewährleistet.

30

25

Eine photokatalytisch aktive Hygieneschutzschicht aus TiO<sub>2</sub> besitzt die Fähigkeit, in feuchter Atmosphäre und unter Tageslicht oder UV-Einstrahlung organi-

sche Verbindungen (Kohlenstoff und/oder Stickstoff enthaltende Verbindungen, wie ÖI, Bakterien) an der Oberfläche zu zerstören. Dank der Reduktion des Kontaktwinkels zwischen Wasser und der TiO<sub>2</sub>-Oberfläche der Oberschicht resultiert zusätzlich ein Anti-Fogging-Effekt und ein begünstigter Abtransport von Staubpartikeln. Dieser auch Selbstreinigungseffekt genannte Hygieneschutz verstärkt synergetisch den passiven Flammschutz, eines brennbaren Substrats. In diesem Fall handelt es sich um einen aktiven und reaktiven Flammschutz.

5

20

Beim passiven Flammschutz wird der direkte Kontakt der Atmosphäre mit einem leicht entflammbaren Substrat durch die erfindungsgemässe Beschichtung mit dem thermisch stabilem Titanoxid herabgesetzt werden, welches bei einem Brand eine Kruste aus erhitztem Titanoxid bildet. Die Flammausbreitungsgeschwindigkeit wird durch die Kruste reduziert und die Entwicklung von aus dem Substrat entweichenden Gasen wird herabgesetzt (Diffusionsbarriere), was schliesslich zur Auslöschung der Flamme durch passiven Schutz führen kann.

Die Erfindung wird anhand von in der Zeichnung dargestellten Ausführungsformen, welche auch Gegenstand von abhängigen Ansprüchen sind, näher erläutert. Die meist teilweisen Querschnitte zeigen schematisch:

- Fig. 1 einen folienförmigen Verbundwerkstoff mit einer einseitig abgeschiedenen Titanoxidschicht,
- Fig. 2 eine Variante gemäss Fig. 1 mit einer zweiteiligen Titanoxidschicht
- 25 Fig. 3 eine Variante von Fig. 2 mit beidseits abgeschiedener Titanoxidschicht,
  - Fig. 4 eine Faser mit einer dreiteiligen Titanoxidschicht, und
  - Fig. 5 eine Variante gemäss Fig. 2 mit einer zusätzlichen Schutzschicht.

Fig. 1 zeigt einen Verbundwerkstoff 10 mit einem Substrat 1 und einer einseitig aufgebrachten Titanoxidschicht 2 ohne nähere Spezifizierung. Fig. 1 entspricht dem üblichen Stand der Technik, es ist eine Titanschicht 2 auf ein Substrat 1

aufgebracht, wo sie eine Schutz- oder andere Funktion erfüllt. Fig. 1 zeigt jedoch auch einen Spezialfall der vorliegenden Erfindung. Es ist eine dünne TiO<sub>x</sub>-Schicht aufgetragen worden, welche zu TiO<sub>2</sub> postoxidiert ist. Wegen der extrem dünnen Schicht ist die TiO<sub>x</sub>-Schicht über die ganze Dicke zu TiO<sub>2</sub> oxidiert worden. Das lediglich teilweise dargestellte Substrat 1 kann z.B. eine Folie, ein Gewebe, eine Membrane, eine Platte, eine Faser, ein Rohr, ein Kabel oder ein Behälterteil sein und aus einem üblichen Material bestehen.

5

25

In Fig. 2 ist die Titanoxidschicht 2 in eine Grundschicht 3 aus TiO<sub>x</sub>, wobei der Sauerstoffgehalt 0.7 ≤ x < 2 ist, und eine Oberschicht 4 aus TiO<sub>2</sub> unterteilt. Im Substrat 1 sind submikrone Partikel 6 aus einem Metalloxid/Metallhydroxid feindispers verteilt. Die Oberschicht 4 aus TiO<sub>2</sub> liegt mehrheitlich in der tetragonalen Kristallstruktur Anatase vor.

Der Übergang von der Grundschicht 3 zur Oberschicht 4 ist scharf gezeichnet. Falls die Grundschicht 3 mittels Postoxidation teilweise in eine Oberschicht 4 umgewandelt wird, ist der Übergang fliessend.

Fig. 3 zeigt einen Verbundwerkstoff 10 mit beidseits aufgebrachter Titanoxid-20 schicht 2. Die Struktur dieser Titanoxidschicht 2 entspricht derjenigen von Fig. 2.

In Fig. 4 ist das Substrat 1 eine Textilfaser, direkt auf der Grundschicht 3 ist eine elektrisch leitende Zwischenschicht 5 abgeschieden, welche die direkt auf der Faser abgeschiedene Grundschicht 3 zylindermantelförmig umhüllt. Diese elektrisch leitende Zwischenschicht 5 besteht aus  ${\rm TiO_x}$  und hat einen Sauerstoffgehalt von 0.7 < x < 1.5. Über der Zwischenschicht liegt die ebenfalls zylindermantelförmig ausgebildete Oberschicht 4.

30 Gewisse Kunststoffsubstrate werden von Titanoxidschichten zumindest oberflächlich zersetzt. In der Ausführungsform gemäss Fig. 5 ist deshalb eine Schutzschicht 7 direkt auf das Substrat 1 abgeschieden, wobei diese Schutzschicht 7 eine ebenfalls im Nanometerbereich liegende Dicke hat. Diese ebenfalls beidseits angebrachte Schutzschicht 7 besteht aus wenigstens einem Metalloxid, vorzugsweise der Gruppe ZnO, MgO, ZrO<sub>2</sub>, In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und SiO<sub>2</sub>, oder aus einer polaren Adhäsionsschicht, beispielsweise eine polare Plasmaschicht, welche zusätzlich eine gute Haftung zum Substrat 1 bewirkt.

#### Tabelle 1

Die Beschichtungstechniken und Prozessparameter werden den Anforderungen an das zu beschichtende Substrat bzw. herzustellendes Produkt angepasst. In der Tabelle 1 ist die Herstellung von ausgewählten funktionalen Titanoxid-Schichten und ihre Schutz- und/oder Funktionswirkung aufgeführt. In der Grundschicht B wurde ein relativ hoher Gehalt an Wasserstoff mit ERDA (Elastic Recolil Detection Analysis) analysiert, der in Form von Hydroxidionen in der Schicht gebunden ist und von den Prozessparametern und der Substrattemperatur abhängt.

Beidseitig beschichtete Verbundwerkstoffe werden jeweils mit derselben Schicht versehen. Während des Beschichtungsprozesses beträgt die Substrattemperatur < 200 °C. Der Anti-Fogging-Effekt wird bei einer Oberflächenspannung von > 50 mN/m und einer entsprechend glatten Oberfläche beobachtet. Die Oberflächenspannung hängt ebenfalls von den Prozessparametern bei der Herstellung der Schicht ab.

25

30

20

Die Wärmekapazität der beschichteten gewebeförmigen Substrate nimmt mit steigender Schichtdicke nahezu linear zu. Entsprechend der beschichteten Oberfläche ist der Effekt bei der PET-Folie höher als bei dem PET-Gewebe ersichtlich. Das dickere Gewebe-Gemisch bestehend aus 36% Polyester und 64% Viskose C weist einen deutlich weniger markanten Effekt auf, als das feine PET-Gewebe. Aus diesen Daten ist ersichtlich, dass die Schichtdicke dem je-

weiligen Substrat (Material, Textur, Dicke) angepasst werden sollte, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

Die durchschnittliche Flammausbreitungsgeschwindigkeit sollte für Textilien allgemeiner Art weniger als 90 mm/s, für textile Vorhänge weniger als 60 mm/s betragen. Bereits mit einer 12 nm dünnen keramischen Beschichtung wird beim feinen PET-Gewebe der Grenzwert von 60 mm/s der Flammausbreitungsgeschwindigkeit unterschritten und erreicht bei einer Schichtdicke von 180 nm einen Wert von 31 mm/s. Beim Viskose/Polyester-Gemisch ist eine signifikante Reduktion von 142 auf 115 mm/s mit einer 95 nm dicken TiO<sub>x</sub>/TiO<sub>2</sub>-Schicht erreicht worden.

ur Herstellung von ausgewählten keramischen Metalloxid-Schichten mit einigen Schutz- bzw. Funktionswirkungen

	Trans- Bemerkungen mission <sup>®</sup> [%]		Grundschicht 3	Oherschicht 4	theire & Section 1	Werkston-Schicht	Grundschicht 3		Zwischenschicht.	25 Oberschicht 4	Grundschicht 3	-	Oberschicht 4		Werkstoir-Schich	Grundschicht 3	Zwischenschicht	ю.	Oberschicht 4	Werkstoff-Schicht	Grundschicht 3		Oberschicht 4	<del>-                                    </del>	42 Werkstoff-Schicht
-	BIF <sup>d</sup> T				-	-								8	93				-	22					120
	Flammaus- breitungsge- schwindigkeit <sup>c</sup> [mm/s]					6.0 55 3.0 31								7	- 115					- 20					
	[Vol%]					5 10								ω :	15							•			
	Spez. Wärme- kapazität Δ [J/gK]					1.6			<del>-</del>					2.4	0. <del>1.</del> 0. 4.				1	3.3				1	
Cileti Metallo	Stöchio- metrie, Struktur <sup>a</sup>		TiO <sub>1.9</sub>		TiO <sub>2</sub>		TiO <sub>1.7</sub> (OH) <sub>0.4</sub>		TiO <sub>0.8</sub>	TiO2	TIO <sub>1.9</sub>	-	TiOz	1		MgO	TiOta	LIO,			Ç	e .	TiO2		
n kerainis	Dicke [nm]		12/180			2 x 12 2 x 180	360		75	20	02		25	2×95	2 x 95	8	15	. rc	)	2 × 100	2014	<del>2</del>	350	}	1×390
usgewanite	P <sub>(02</sub> / P <sub>tot</sub> [%]		15		8		10		7.5	72	7.5		20			0	c	· c	•	1	8	જ —		3	1
lung von a	Prozess- druck [ubar]		10		200		7		12	70	15		23	1		15	2	2 8	3			1000	2000	2007	
ır Herstel	Leistung [W]		2000		800		800		1000	1000	009		1000	1		1500	200	3 5	3			1900	2700	317	
Tab. 1: Beispiele von Prozessverfahren zur Herstellung von ausgewaniten keranischen imeranozur-och in der der stellung von ausgewaniten keranischen imeranozur-och in der der stellung von ausgewaniten keranischen im der	Verfahren		Reaktives DC-Sputtern	von TI(s) + O <sub>2</sub>	<ul> <li>Plasma-Postoxidation</li> </ul>	85 µm dickes Substrat	Reaktives DC-Sputtern	von Ti(s) + O <sub>2</sub>	Reaktives DC-Sputtern von Ti(s) + O <sub>2</sub>	Reaktives DC-Sputtern  von Ti(s) + Os	Reaktives RF-Sputtern	von Ti(s) + O <sub>2</sub>	Reaktives RF-Sputtern     Reaktives RF-	von 11(s) + O <sub>2</sub> 85 μm dickes Substrat	12 μm dickes Substrat	64%/36% Gemisch	OF Continue of the Continue of	DE-Sprittern von	TiO <sub>2</sub> (s)	85 µm dickes Substrat	12 μm dickes Substrat	Plasma MO-CVD mit     TIO_CH(CH <sub>2</sub> )	Plasma MO-CVD mit	Ti(O-CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> und E <sub>2</sub> (C <sub>2</sub> H-O <sub>2</sub> ) <sub>3</sub>	12 um dickes Substrat
ab. 1: Beispiel	Schicht	Substrat		∢		<del></del>	LEI-Gewene	α	1			Ċ	>	PET-Gewebe	PET-Folie	Viskose/PE1		د		PET-Gewebe	PET-Folie		ш		PFT-Folie

**ERSATZBLATT (REGEL 26)** 

### Legende:

- a Die Stöchiometrie der Schichten und der Schichtoberfläche wurde mit RBS (Rutherford Backscattering Spektroskopie), ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis) und XPS (X-ray Photoelektronen Spektroskopie) bestimmt. Die Kristallstruktur der Schichten wurde mit TEM (Transmission Elektronen Spektroskopie) und XRD (Röntgen) qualitativ analysiert. In den Gemischen aus den amorphen und diversen kristallinen Phasen (Anatase, Rutil und Suboxiden TiO<sub>x</sub> (0.5 ≤ x < 2) konnten jeweils die betreffenden Phasen identifiziert werden.
- b Der LOI (Limiting Oxygen Index) ISO 4589-2 / ASTM D2863-77 beschreibt die Zunahme des limitierenden Sauerstoff Gehaltes in einem Gasgemisch in vol.% bei einer Flamme, um den beschichteten Werkstoff zu verbrennen.
- c Brenngeschwindigkeit, welche gemäss Test 4589-2 / ASTM D2863-77durchgeführt wurde (linke Kolonne) und durchschnittliche Flammausbreitungsgeschwindigkeit, welche gemäss dem Brenntest BS EN ISO 6941 durchgeführt wurde (rechte Kolonne).
- d Der BIF (Barrier Improvement Factor) gibt an, um welchen Faktor die Sauerstoff Durchlässigkeit (gemessen in [ccm/(m²·d·bar)], gemäss ASTM D 3985-95 bei 0% rel. Feuchtigkeit und 23°C) durch die Beschichtung der 12 μm dicken PET-Folien im Vergleich zur unbeschichteten PET-Folie (124 ccm/(m²·d·bar) abnimmt.
- e Ein beschichteter, vorbestrahlter Glas-Werkstoff wird in eine 0.05 mmol wässrige Methylenblau-Lösung getaucht und mit einer UV-Lampe (2 mW/cm²) bestrahlt. Die Transmissionsänderung der Lösung wird nach 96 Stunden in einem Spektrophotometer bei einer Wellenlänge von 650 nm gemäss Sinku-Riko PCC-1 gemessen.

Die elektrische Leitfähigkeit bzw. der elektrische Widerstand der jeweiligen Zwischenschicht 5 ist in Beispiel 3 angegeben. Der elektrische Widerstand einer 100 nm dicken  $\text{TiO}_2$ -Schicht beträgt mehr als  $2 \cdot 10^5 \,\Omega$  cm.

PCT/CH2003/000653

WO 2004/029323

16

### Beispiele

5

Im Folgenden werden einige Beispiele zur Herstellung von multifunktionalen Titanoxidschichten beschrieben. In jedem Fall werden die Schichteigenschaften und die Schichtstruktur den jeweiligen Produktanforderungen angepasst.

## Beispiel 1: Reaktives Magnetron Sputtern mit anschliessender Postoxidation

Abscheidung einer Titanoxid-Schicht 2 auf ein beliebiges Substrat 1 mit einem reaktiven Sputterprozess (DC = (gepulster) Gleichstrom; RF = Radiofrequenz) von Titan mit einem Gemisch von Prozessgasen aus Argon und Sauerstoff. Anschließend wird durch die Änderung der Plasmabedingungen (Variante 1a) und/oder mit einer Postoxidation (Variante 1b) des Verbundwerkstoffs eine Anatase enthaltende TiO<sub>2</sub>-Oberschicht 4 gebildet.

#### Beschichtungsprozess:

Target:

Titan-Metall (99.98 %)

20 Leistung:

1 - 7 W/cm<sup>2</sup> DC / RF

Prozessdruck:

10 μbar

Partialdruck p(O<sub>2</sub>)/p(tot):

10 % DC / RF

Variante 1a: TiO2-Schicht am Schluss des Prozesses

25

30

In der letzten Phase des reaktiven Sputterprozesses wird der Prozessdruck auf 20 µbar erhöht und im Falle des DC-Sputterprozesses der Sauerstoff-Partialdruck auf 30 % erhöht, im Falle des RF-Sputterprozesses wird der Sauerstoff-Partialdruck auf 60 % erhöht. Die Erhöhung des Prozessdruckes und des Sauerstoff-Partialdruckes wirkt sich auf die Schichteigenschaften der Oberschicht günstig aus, welche sich durch eine tiefere Dichte, einer höheren Porosität und dadurch mit einer größeren Oberfläche auszeichnet.

### Variante 1b: Postoxidation von TiOx zu TiO2

In diesem Fall wird die Titanoxid-Schicht mit einem PE-CVD bei Niederdruck bis Atmosphärendruck in einer oxidierenden Atmosphäre oxidiert. Die Eindringtiefe der Postoxidation hängt von der Dichte der TiO<sub>x</sub>-Schicht und von den Prozessbedingungen ab.

Leistung (gepulst / kontin.): 50 - 3000 W Radiofrequenz (MHz), Höchstfrequenz

10 (GHz) oder Niederfrequenz (kHz)

Prozessdruck: 0.1 mbar bis 1 bar

Partialdruck  $p(O_2)/p(tot)$ : 50 - 100 %

## 15 Beispiel 2: Haftvermittelnde Vorbehandlung und Plasma-aktiviertes MOCVD-Verfahren

Es erfolgt eine Plasma-Aktivierung eines Substrates (1), um die Adhäsion der Beschichtung zu erhöhen.

20

Vorbehandlung:

Leistung (gepulst / kontin.): 200 – 1500 W Höchstfrequenz (2.45 GHz)

Prozessdruck: 20 μbar bis 1 bar

Partialdruck  $p(O_2/N_2O)/p(tot)$ : 20 - 80 %

25

30

Grundschicht 4 bestehend aus TiO<sub>x</sub> oder TiO<sub>x</sub> gemischt mit SiO<sub>x</sub>:

Anschliessend wird ein titan-haltiges Monomergas, beispielsweise Titan-Tetra-kis-Isopropoxid (TTIP) (Ti(O-CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>)<sub>4</sub>) gemeinsam mit Sauerstoff und einem oder mehreren Edelgasen (Ar, He) in die Reaktionskammer eingeleitet und eine TiO<sub>x</sub>-Schicht 4 abgeschieden. Zusätzlich kann Hexamethyldisiloxan (HMDSO) in den Plasmaprozess eingeleitet werden, so dass ein Verhältnis der beiden Metalloxide von 2:1 in der Grundschicht entsteht.

Leistung (gepulst / kontin.):

600 - 3500 W Höchstfrequenz (2.45 GHz)

Prozessdruck:

10 ubar - 0.1 bar

Prozessgase:

Ar / He als Trägergas durch Ti(O-CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>)<sub>4</sub>

bei 50 °C, Ar / He und O<sub>2</sub>

5

10

25

30

Oberschicht 4 bestehend aus TiO2 oder TiO2 dotiert mit Fe2O3:

Auf die Grundschicht 3 werden anschließend zu den titanhaltigen Prozessgasen ein eisenhaltiges Monomergas in kleiner Menge (bsp. Eisen-acetylacetonat-Komplex Fe(C<sub>5</sub>H<sub>7</sub>O<sub>2</sub>)<sub>3</sub>, mit Sauerstoff und einem oder mehreren Edelgasen (Ar, He, etc.) als Trägergas in die Reaktionskammer eingeleitet, um eine Anatase enthaltende TiO<sub>2</sub>-Oberschicht 4 dotiert mit 0.1 - 9 at% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> abzuscheiden. Gleichzeitig kann durch Variation der Prozessparameter die Schichtstruktur geändert werden.

Mit Hilfe von zahlreichen energiereichen plasma-aktivierten Entladungen vom Niederfrequenz- bis zum Höchstfrequenzbereich und Kombinationen daraus ist es möglich die beschriebenen Verbundwerkstoffe herzustellen. Als Beispiele werden genannt: (Remote) AP-PECVD (atmospheric pressure plasma enhanced chemical vapour deposition), APNEP (atmospheric pressure non-equilibrium plasma) Plasma-Jet, Plasmabreitstrahlbrenner, Mikrowellen-Entladung, Pulsing Surface Discharge, DBD (Dielectric Barrier Discharge), APGD (Atmopheric Pressure Glow Discharge).

### Beispiel 3: Elektrisch leitfähige TiO<sub>x</sub>-Zwischenschicht 5

Es wird eine elektrisch leitfähige Zwischenschicht 5 hergestellt, welche leitfähiger als die Grundschicht 3 und/oder die zusätzliche Grundschicht 7 ist. Die  $TiO_{x}$ -Schicht (0.7  $\leq$ x < 1.5) wird auf ein mit einer Grundschicht 3 versehenen beliebigen Substrat 1 abgeschieden, indem bei einem reaktiven Sputterprozess weniger Sauerstoff-Gas als bei der Grundschicht 3 dem Prozess zugeführt wird und der Prozessdruck angepasst wird. Es besteht auch die Möglichkeit, eine

WO 2004/029323 PCT/CH2003/000653

19

 $TiO_x$ -Schicht nicht-reaktiv mit einem Sputterprozess abzuscheiden, indem ein entsprechendes Target (TiO,  $Ti_2O_3$ ,  $Ti_3O_2$ , etc.) verwendet wird.

Reaktiver DC-Sputterprozess um eine  $TiO_{1.0}$ -Schicht mit einem elektrischen Widerstand von  $1.2 \cdot 10^{-2} \Omega$  cm bzw.  $50 \Omega$  cm zu erhalten:

Target:

Titan-Metall (99.98 %)

Leistung:

3 W/cm<sup>2</sup> DC

Prozessdruck:

20 μbar bzw. 7 μbar

Partialdruck p(O<sub>2</sub>)/p(tot):

5 % bzw. 7.5 %

10

### Patentansprüche

Verbundwerkstoff (10) aus einem Substrat (1) mit einer wenigstens einseitig aufgebrachten chemisch, mechanisch, physikalisch, katalytisch und/oder optisch funktionalen Titanoxidschicht (2),

dadurch gekennzeichnet, dass

auf dem Substrat (1) eine Titanoxidschicht (2) aus einer Grundschicht (3) aus  $TiO_x$  mit einem Sauerstoffgehalt von  $0.7 \le x < 2$  oder aus  $TiO_x$  (OH) $_y$  mit einem Sauerstoffgehalt von  $0.5 \le x < 2$  und einem Hydroxidgehalt von  $0.5 \le y < 0.7$  und auf dieser Grundschicht (3) eine Oberschicht (4) aus amorphem und/oder kristallinem  $TiO_2$  aufgebracht ist.

- Verbundwerkstoff (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Titanoxidschicht (2) eine gesamte Schichtdicke von 3 bis 1000 nm aufweist, wobei mindestens etwa 10% der gesamten Schicht (2) aus der Oberschicht (4) bestehen.
- 3. Verbundwerkstoff (10) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Titanoxidschicht (2) eine gesamte Schichtdicke von 10 bis 200 nm, vorzugsweise 20 bis 150 nm, aufweist.
- 4. Verbundwerkstoff (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Substrat (1) und der Grundschicht (3) der Titanoxidschicht (2) eine Schutzschicht (7) aus wenigstens einem Metalloxid der Gruppe, bestehend aus ZnO, MgO, ZrO<sub>2</sub>, In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und SiO<sub>2</sub>, und/oder einer polaren Adhäsionsschicht, abgeschieden ist, vorzugsweise mit höchstens gleicher Schichtdicke wie die Titanoxidschicht (2).

- 5. Verbundwerkstoff (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundschicht (3) aus TiO<sub>x</sub> wenigstens ein Metalloxid der Gruppe, bestehend aus MgO, ZnO, ZrO<sub>2</sub>, In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und SiO<sub>2</sub>, zugemischt und/oder wenigstens ein Metalloxid der Gruppe, bestehend aus Fe2O<sub>3</sub>,WO<sub>3</sub>, MnO<sub>2</sub>, NiO, BaO und CaO, zudotiert ist, wobei der gesamte Anteil aller Metalloxide unterhalb 50 Gew.-% und der gesamte Anteil der Metalloxide der zweiten Gruppe unterhalb 7 Gew.-% bleibt.
- 6. Verbundwerkstoff (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Grundschicht (3) und der Oberschicht (4) der Titanoxidschicht (2) eine elektrisch leitende Zwischenschicht (5) abgeschieden ist, welche vorzugsweise aus TiO<sub>x</sub> mit einem Sauerstoffgehalt von 0.7 ≤ x ≤ 1.5 besteht.
- 7. Verbundwerkstoff (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens die neun obersten Atomlagen der Oberschicht (4) der Titanoxidschicht (2) vorwiegend aus der TiO<sub>2</sub>-Modifikation Anatase bestehen.
- Verbundwerkstoff (10) mit einem Kunststoffsubstrat (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass dem Kunststoffsubstrat (1) vorzugsweise submikrone Füllerpartikel (6) aus einem Metalloxid oder einem bei Hitze wasserabspaltenden Metallhydroxid feindispers zugemischt sind.
- Verbundwerkstoff (10) mit einem brennbaren Substrat nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die TiO<sub>x</sub>-Grundschicht (3) der Titanoxidschicht (2) einen Sauerstoffgehalt von 1.5 ≤ x ≤ 1.9 oder die TiO<sub>x</sub> (OH)<sub>y</sub> einen signifikanten Hydroxidgehalt von vorzugsweise 0.2 < y < 0.7 aufweist, hat.</li>

 Verfahren zum Abscheiden einer chemisch, physikalisch, mechanisch, katalytisch und/oder optisch funktionalen Titanoxidschicht (2) auf einem Substrat (1),

dadurch gekennzeichnet, dass

vorerst reaktiv oder nicht reaktiv eine Grundschicht (3) auf  $TiO_x$  mit einem Sauerstoffgehalt von  $0.7 \le x < 2$ , dann durch Erhöhen des Sauerstoffgehalts, des Prozessdrucks, der Leistung und/oder der Substrattemperatur, eine Oberschicht (4) aus amorphem und/oder kristallinem  $TiO_2$  abgeschieden wird.

 Verfahren zum Abscheiden einer chemisch, physikalisch, mechanisch, katalytisch und/oder optisch funktionalen Titanoxidschicht (2) auf einem Substrat (1),

dadurch gekennzeichnet, dass

vorerst reaktiv oder nicht reaktiv eine Grundschicht (3) aus  $TiO_x$  mit einem Sauerstoffgehalt von  $0.7 \le x < 2$  abgeschieden und anschliessend elektrochemisch, thermisch, und/oder mit einem Plasmaprozess an der Oberfläche postoxidiert wird, bis die Grundschicht (3) wenigstens teilweise in eine Oberschicht (4) aus amorphem oder kristallinem  $TiO_2$  umstrukturiert ist.

- 12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass eine mit wenigstens einem Metalloxid, vorzugsweise der Gruppe, bestehend aus Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, WO<sub>3</sub>, MnO<sub>2</sub>, NiO, BaO und CaO, dotierte Oberschicht (4) aus TiO<sub>2</sub> abgeschieden wird, wobei insgesamt weniger als 7 Gew.-% zudotiert werden.
- Verwendung eines Verbundwerkstoffs (10) mit einem Substrat (1) aus einem Kunststoff nach einem der Ansprüche 1 bis 12 zur Erhöhung der



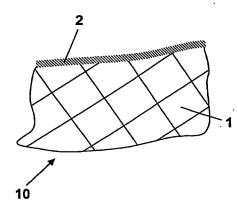
WO 2004/029323 PCT/CH2003/000653

23

thermischen Stabilität und Flammhemmung bei polymeren Materialien in Form von Folien, Membranen, Fasern, Pulvern, Textilien, Geweben, Rohren und Behältern.

14. Verwendung eines Verbundwerkstoffs (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 12 als aktiver Hygieneschutz für die Aufbereitung von Trinkwasser. wässrigen Lösungen und Luft, für Textilien, Vorhänge, Tapeten, Folien, Membrane, Kabel, Verpackungen, Glaswaren, Fenster, Composit-Werkstoffe, Elemente der Medizinaltechnik, Photo-Voltaik und optische Systeme, Gassensoren und elektronische Schaltkreise.

### 1/1



<u>Fig. 1</u>

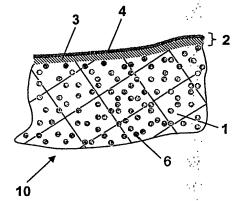


Fig. 2

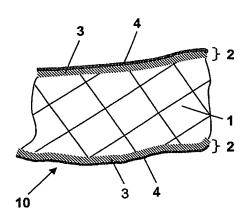


Fig. 3

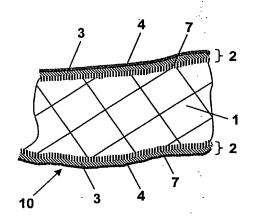
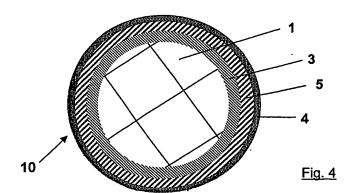


Fig. 5





### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internal of Application No PCT/CH 03/00653

A. CLASSIF IPC 7	ICATION OF SUBJECT MATTER C23C14/08 C23C30/00		
		ter and IDO	
	International Patent Classification (IPC) or to both national classificat	ion and IPC	
B. FIELDS S	SEARCHED cumentation searched (classification system followed by classification	a cymbole)	
IPC 7	C23C	T Symbolsy	
Documentati	on searched other than minimum documentation to the extent that su	ch documents are included in the fields sea	ırched
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data base	e and, where practical, search terms used)	ļ
WPI Dat	ta, PAJ, EPO-Internal, INSPEC		·
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	vant passages	Relevant to claim No.
Odicgory	Olation of document		
х	WO 01 71055 A (NIPPON SHEET GLASS ;ANZAKI TOSHIAKI (JP); KIJIMA YOS 27 September 2001 (2001-09-27)	CO LTD HIFUMI)	1,11,14
A	examples 4,5,8		10
X	BEN AMOR S ET AL: "Photoprotecti titania coatings on PET substrate SURFACE AND COATINGS TECHNOLOGY, 1998, ELSEVIER, SWITZERLAND, vol. 102, no. 1-2, pages 63-72, XP002240840 ISSN: 0257-8972 cited in the application page 63, right-hand column, line 65, left-hand column, line 16	s" 1 APRIL 5 —page	1,7
	-	·/	
Ì			
X Fur	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
Special ca	ategories of cited documents:	"T" later document published after the inte	mational filing date
consi	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention  "X" document of particular relevance; the c	the application but cory underlying the
filing	date ent which may throw doubts on priority claim(s) or	cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do	be considered to
which	is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an inv	laimed invention ventive step when the
	nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	document is combined with one or mo ments, such combination being obvious	ore other such docu-
'P' docum	nent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	in the art.  *&* document member of the same patent	family
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	arch report
	13 January 2004	20/01/2004	
Name and	mailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Flijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fay: (+31-70) 340-2016	Patterson, A	



### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

	Internal al Application No
Ì	PCT/CH 03/00653

0.6		PUI/CH 03	7 00033
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	······································	<b>,</b>
Calegory °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
A	DE 25 19 403 A (FUJI PHOTO FILM CO LTD) 13 November 1975 (1975-11-13) claims 1,8-13; examples		1-14
A	RAO K N: "Influence of deposition parameters on optical properties of TiO/sub 2/ films"  OPTICAL ENGINEERING, SEPT. 2002, SPIE, USA, vol. 41, no. 9, pages 2357-2364, XP001149929 ISSN: 0091-3286 abstract		1-14

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)



### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

## Internation No PCT/CH 03/00653

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 0171055	A	27-09-2001	AU WO US	4114401 A 0171055 A1 2003064179 A1	03-10-2001 27-09-2001 03-04-2003
DE 2519403	A	13-11-1975	JP JP JP JP JP DE GB US	1175536 C 50141323 A 58008497 B 1175537 C 50157467 A 58008498 B 2519403 A1 1464051 A	14-11-1983 13-11-1975 16-02-1983 14-11-1983 19-12-1975 16-02-1983 13-11-1975 09-02-1977



### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ales Aktenzeichen

		PCT/CH	03/00653
a. klassi IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C23C14/08 C23C3O/00		
Nach der In	ternationalen Pateniklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssifikation und der tPK	
	RCHIERTE GEBIETE		
Recherchie IPK 7	nter Mindesiprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo C23C	ole )	
	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so		
	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N ta, PAJ, EPO-Internal, INSPEC	ame der Datenbank und evtl. verwend	tete Suchbegriffe)
CALCINE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kalegorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 01 71055 A (NIPPON SHEET GLASS ;ANZAKI TOSHIAKI (JP); KIJIMA YOS 27. September 2001 (2001-09-27)		1,11,14
A	Beispiele 4,5,8		10
X	BEN AMOR S ET AL: "Photoprotecti titania coatings on PET substrate SURFACE AND COATINGS TECHNOLOGY, 1998, ELSEVIER, SWITZERLAND, Bd. 102, Nr. 1-2, Seiten 63-72, XP002240840 ISSN: 0257-8972 in der Anmeldung erwähnt Seite 63, rechte Spalte, Zeile 565, linke Spalte, Zeile 16	es" 1 APRIL	1,7
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamille	
"A" Veröffe aber n "E" älteres Anmel "L" Veröffer schein anden soll oc ausge "O" Veröffe eine B "P" Veröffe dem b	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,  licht als besonders bedeutsam anzusehen ist  Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen  tidedatum veröffentlicht worden ist  ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- nen zu Lissen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einen  im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden  ter die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie  führt)  intlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,  einenzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht  mitlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach  eanspruchten Priorifätsdatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegeben ist  "X" Veröffentlichung von besonderer B kann allein aufgrund dieser Veröffe erfinderischer Tältigkeit beruhend I  "Y" Veröffentlichung von besonderer B kann nicht als auf erfinderischer T werden, wenn die Veröffentlichung Veröffentlichungen dieser Kategor diese Verbindung für einen Fachn  "&" Veröffentlichung, die Mitglied derse	tlicht worden ist und mit der n nur zum Verständnis des der zips oder der ihr zugrundellegenden edeutung; die beanspruchte Erfindung entlichung nicht als neu oder auf betrachtet werden edeutung; die beanspruchte Erfindung äligkeit beruhend betrachtet j mit einer oder mehreren anderen ie in Verbindung gebracht wird und lann naheliegend ist eiben Patentfamilie ist
	Abschlusses der Internationalen Recherche  3. Januar 2004	Absendedatum des internationale	н неспекиепреясліз
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bedlensteter Patterson, A	



### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ļ	Interna ales Aktenzeichen
	PCT/CH 03/00653

	PCT/CH 03/00653						
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN						
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommer	nden Telle	Betr. Anspruch Nr.				
A	DE 25 19 403 A (FUJI PHOTO FILM CO LTD) 13. November 1975 (1975-11-13) Ansprüche 1,8-13; Beispiele		1-14				
A	RAO K N: "Influence of deposition parameters on optical properties of TiO/sub 2/ films" OPTICAL ENGINEERING, SEPT. 2002, SPIE, USA, Bd. 41, Nr. 9, Seiten 2357-2364, XP001149929 ISSN: 0091-3286 Zusammenfassung		1-14				
			·				

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992)



### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

## Internal Ales Aklenzekhen PCT/CH 03/00653

im Recherchenbericht angeführtes Patentdokume	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er).der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung		
WO 0171055	A	27-09-2001	AU WO US	4114401 A 0171055 A1 2003064179 A1	03-10-2001 27-09-2001 03-04-2003	
DE 2519403	A	13-11-1975	JP JP JP JP JP DE GB US	1175536 C 50141323 A 58008497 B 1175537 C 50157467 A 58008498 B 2519403 A1 1464051 A 4078935 A	14-11-1983 13-11-1975 16-02-1983 14-11-1983 19-12-1975 16-02-1983 13-11-1975 09-02-1977 14-03-1978	

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.